

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005年7月21日 (21.07.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/066658 A1

(51) 国際特許分類: G01T 1/29, G21K 5/04, H01J 37/317, 37/04, H01L 21/265 LTD.) [JP/JP]; 〒6018205 京都府京都市南区久世殿町 575 番地 Kyoto (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/019833 (72) 発明者; および
(22) 国際出願日: 2004年12月28日 (28.12.2004) (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 海勢頭 聖 (UMISEDO, Sei). 濱本 成穎 (HAMAMOTO, Nariaki).

(25) 国際出願の言語: 日本語 (74) 代理人: 内藤 照雄 (NAITO, Teruo); 〒1076012 東京都港区赤坂一丁目12番32号アーク森ビル12階信栄特許事務所 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語: 日本語 (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI,

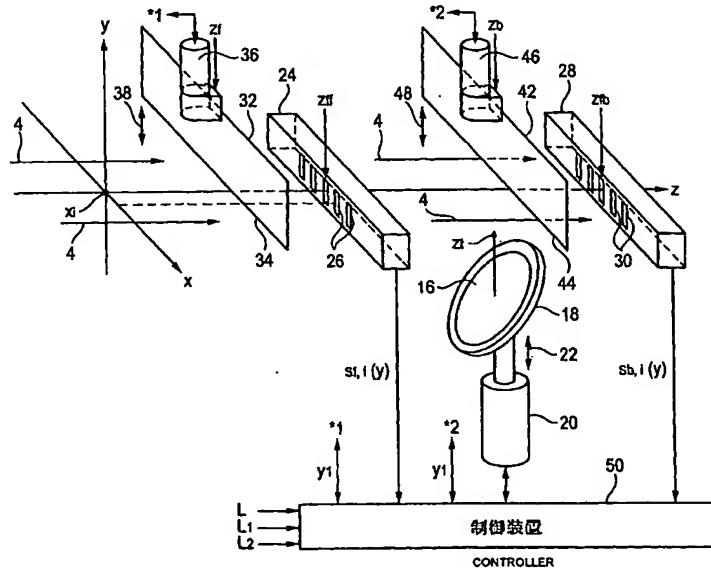
(30) 優先権データ:
特願2004-001006 2004年1月6日 (06.01.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 日新イオン機器株式会社 (NISSIN ION EQUIPMENT CO.,

(統葉有)

(54) Title: ION BEAM MEASURING METHOD AND ION IMPLANTING APPARATUS

(54) 発明の名称: イオンビーム計測方法およびイオン注入装置





NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 國際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約: 前段シャッター駆動装置36によって前段ビーム制限シャッター32をy方向に駆動しつつ、当該シャッター32の一辺34の外側を通過して前段多点ファラデー24に入射するイオンビーム4のビーム電流の変化を計測して、前段ビーム制限シャッター32の位置でのイオンビーム4のy方向のビーム電流密度分布を計測する。かつ、後段シャッター駆動装置46によって後段ビーム制限シャッター42をy方向に駆動しつつ、当該シャッター42の一辺44の外側を通過して後段多点ファラデー28に入射するイオンビーム4のビーム電流の変化を計測して、後段ビーム制限シャッター42の位置でのイオンビーム4のy方向のビーム電流密度分布を計測する。そしてこの計測結果を用いて、イオンビーム4のy方向の角度偏差、発散角およびビームサイズの内の少なくとも一つを計測する。